

# 日本化粧品技術者会誌 Vol.47, No.3 (2013年9月号) 目次

## 特集総説 紫外線防御化粧品を支える技術と製剤 ①

太陽光線に対する皮膚生理反応について..... 正木 仁 197

## 報 文

頭皮マッサージの生理的、心理的指標に及ぼす効果 (英文)

..... 島田邦男, 土田 衛, 大西日出男, 中野博子, 大東俊一 202

新規 UV-B 吸収剤: ジオクチルメトキシベンジリデンマロネートの設計と UV-A 吸収剤光安定化効果

..... 小口 希, 宮沢和之, 菊地あづさ, 八木幹雄 209

天然保湿因子 (NMF) 産生酵素の性質とバリア機能 ..... 日比野利彦 216

## ノ ー ト

イオン対高速液体クロマトグラフィーによるユーメラニン, フェオメラニン定量法

..... 怒田和美, 奥村 浩, 葉谷 彰, 鳥居宏右, 若松一雅, 伊藤祥輔 221

## 技術情報

日本化粧品工業連合会技術情報 (No. 376, 377) ..... 227

Journal of Cosmetic Science (Vol. 64, No. 2) ..... 249

International Journal of Cosmetic Science (Vol. 35, No. 2) ..... 252

## 本会の記事

日本化粧品技術者会のご案内 ..... 257

会の動静 ..... 260

## 学会行事予告

第 42 回 SCCJ セミナー / IFSCC リオデジャネイロ中間大会 / 第 73 回 SCCJ 研究討論会 /

第 43 回 SCCJ セミナー / 第 74 回 SCCJ 研究討論会 / IFSCC フランス大会 / 第 60 回

界面科学部会秋季セミナー / 日本油化学会 2013 年度オレオマテリアル部会 (関東支部)

セミナー ..... 263

日本化粧品技術者会誌投稿規定 ..... 265

日本化粧品技術者会誌投稿の手引き ..... 266

SI 単位表 ..... 268

協賛広告一覧 ..... 268

雑感 ..... 前山 薫 269

編集後記 ..... 松井 正 269

## 表紙

デザイン: 小林 豊 (資生堂宣伝制作部)

写 真: 中村成一 (中村写真事務所)

# Journal of SCCJ Vol.47, No.3 Contents

## Special Review

Physiological Reactions in the Skin Exposed to Solar Light ..... Hitoshi Masaki 197

## Originals

Effects of Scalp Massage on Physiological and Psychological Indices  
..... Kunio Shimada, Mamoru Tsuchida, Hideo Ohnishi, Hiroko Nakano, Shun-ichi Daito 202

Diocetyl 4-Methoxybenzylidenemalonate : A New UV-B Absorber  
..... Nozomi Oguchi (Fujiyama) , Kazuyuki Miyazawa, Azusa Kikuchi, Mikio Yagi 209

Characterization of Natural Moisturizing Factor (NMF) -Generating Enzyme and Its Relevance  
to Barrier Function ..... Toshihiko Hibino 216

## Note

Analysis of Eumelanin and Pheomelanin by Ion-pair High Performance Liquid Chromatography  
..... Kazumi Nuta, Hiroshi Okumura, Akira Hatani,  
Kosuke Torii, Kazumasa Wakamatsu, Shosuke Ito 221

### 複写をご希望の方へ

日本化粧品技術者会は、本誌掲載著作物の複写に関する権利を一般社団法人学術著作権協会に委託しております。本誌に掲載された著作物の複写をご希望の方は、(社)学術著作権協会より許諾を受けて下さい。但し、企業等法人による社内利用目的の複写については、当該企業等法人が社団法人日本複写権センター((社)学術著作権協会が社内利用目的複写に関する権利を再委託している団体)と包括複写許諾契約を締結している場合にあっては、その必要はございません(社外頒布目的の複写については、許諾が必要です)。

権利委託先 一般社団法人学術著作権協会 〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-41 乃木坂ビル 3F  
FAX: 03-3475-5619 E-mail: info@jaacc.jp

複写以外の許諾(著作物の引用、転載、翻訳等)に関しては、(社)学術著作権協会に委託致しておりません。直接、日本化粧品技術者会 info@sccj-ifsc.com へお問い合わせください。